

B.Sc. (HS) Semester - 5 (Remedial) (NEP-2020) Examination**March/April-2026****GHS: (CT) Processing an Apparel Design (Minor-4)****Time: 2:00 Hours****Marks: 50****Instructions:**

1. All questions are compulsory.
2. Figures to the right indicate marks.

પ્રશ્ન.૧	પેટર્ન બનાવવાની મહત્વ જણાવી માપ લેવાની પદ્ધતિઓ સમજાવો	(૧૦)
	અથવા	
પ્રશ્ન.૧	પેટર્ન બનાવવાનું મહત્વ જણાવો, પેટર્ન બનાવવાની પદ્ધતિ સમજાવો	
પ્રશ્ન.૨	લેઆઉટ માટે ફેબ્રિક માટેની પૂર્વ તૈયારીના પગલાં સમજાવો.	(૧૦)
	અથવા	
પ્રશ્ન.૨	જુદી જુદી કાપડ ની ડિઝાઇન્સ પ્રમાણે કાપડના પજા મુજબ ફેબ્રિકનું લેઆઉટ સમજાવો.	
પ્રશ્ન.૩	સીમ્સ પ્રકારોની ચર્ચા કરો	(૧૦)
	અથવા	
પ્રશ્ન.૩	એડિશનલ સીમ્સ ની જુદી જુદી ટેકનીક વિશે માહિતી આપો	
પ્રશ્ન.૪	સ્લીવ્સ અને કોલરના પ્રકાર જણાવો.	(૧૦)
	અથવા	
પ્રશ્ન.૪	પોકેટ અને જુદા જુદા પ્રકારના ટ્રિમ્સ વિશે માહિતી આપો.	
પ્રશ્ન.૫	ટ્રેક નોંધ (કોઈપણ બે)	(૧૦)
	(1) લે આઉટ માટેની જનરલ ગાઈડ લાઈન	
	(2) હેમલાઈનનું ફિનિશિંગ	
	(3) નેક લાઈન	
	(4) ક્રોસવે સ્ટ્રીપ્સ - મહત્વ અને ઉપયોગ	

ENGLISH VERSION

Que.1	Explain the importance of pattern making and the methods of taking body measurements.	(10)
	OR	
Que.1	Describe the importance of pattern making and explain the methods used in pattern making.	
Que.2	Explain the preparatory steps for fabric layout.	(10)
	OR	
Que.2	Explain the layout of fabric based on different fabric designs and grain directions.	
Que.3	Discuss the types of seams.	(10)
	OR	
Que.3	Provide information about different techniques of additional seams.	
Que.4	Mention the types of sleeves and collars.	(10)
	OR	
Que.4	Give information about different types of pockets and trims.	
Que.5	Short Notes - Any Two	(10)
	(1) General guidelines for fabric layout	
	(2) Finishing of hemline	
	(3) Neckline	
	(4) Crossway strips – Importance and usage	
